## НАНОФИЗИКА И наноэлектроника

# Труды XXIII Международного симпозиума

11–14 марта 2019 г., Нижний Новгород

Том 1

Секции 1, 2, 4, 5

Нижний Новгород Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского 2019

### Спин-зависящий электронный транспорт в наноконтакте на основе ферромагнетика, изолятора и антиферромагнетика

#### Н.Х. Усеинов

Институт физики КФУ, ул. Кремлёвская, 18, Казань, 420008.

#### nuseinov@mail.ru

Проводится теоретический расчёт и исследуется спин-зависящий электронный транспорт в планарном наноконтакте FM<sup>L</sup>/I/AFM<sup>R</sup>, состоящем из ферромагнитного (FM) и антиферромагнитного (AFM) металлов, разделённых между собой изолятором I. Намагниченность AFM слоя может изменяться в зависимости от относительных углов между направлениями намагниченностей подрешёток AFM слоя и FM слоя. Вычисляются туннельные коэффициенты прохождения электронов проводимости с учётом спиновых степеней свободы. Рассчитываются кондактанс, туннельное магнитосопротивление как функции физических параметров наноконтакта и приложенного напряжения.

#### Введение

Широкое применение спинтронных устройств в современной наноэлектронике стимулирует разработку теоретических моделей и исследование различных типов многослойных магнитных наноструктур. В последнее время значительное внимание уделяется исследованиям спинтронных эффектов: гигантскому магнитосопротивлению, туннельному магнитосопротивлению (TMC) и переносу спинового момента в наноконтактах включающих антиферромагнитные материалы [1].

Целью исследования является верификация теоретической модели, создание вычислительных алгоритмов для расчёта и моделирования зависимости ТМС от параметров магнитного туннельного контакта (МТК) и приложенного напряжения. Разработанная теория может применяться для интерпретации экспериментальных данных и нахождения условий, необходимых для переключения ферро и/или антиферромагнитных слоистых наноструктур между высокорезистивным и низкорезистивным состояниями.

В работе представлена теоретическая модель, которая позволяет вычислить коэффициенты прохождения, спин-поляризованную проводимость (кондактанс) и ТМС планарного МТК, см. рисунок 1. Контакт моделируется для простоты квадратным сечением изолятора, разделяющим пространство на две половины (левую L и правую R). Левая половина занята однодоменным ферромагнитным металлом (FM<sup>L</sup>), правая половина - антиферромагнитным металлом или сплавом (AFM<sup>R</sup>) с антиколлинеарной намагниченностью двух подрешёток, так называемого «шахматного» магнетика (любые два ближайших соседа имеют противоположные моменты). Ось *x* системы координат направлена перпендикулярно плоскости изолятора, см. рисунок 1.



Рис. 1. Схематическое изображение магнитного туннельного наноконтака FM<sup>L</sup>/I/AFM<sup>R</sup> с ферромагнитным электродом FM<sup>L</sup> слева и антиферромагнитным FM<sup>R</sup> слоем справа, разделённых изолятором I. Толщина изоляционного слоя *d*. Стрелки (и углы θ<sub>1</sub>, θ<sub>2</sub>) показывают направления намагниченностей подрешёток AFM<sup>R</sup> слоя относительно направления намагниченности FM<sup>L</sup> электрода

#### Уравнение Шрёдингера МТК с антиферромагнитным слоем

Для того чтобы вычислить кондактанс  $G_s^x$  вдоль оси *x* МТК необходимо найти полную волновую функцию  $\psi_s(x;k_y,k_z)$ , где  $k_y,k_z$  - волновые числа, соответствующих направлений,  $s = \uparrow, \downarrow$  - спиновый индекс. Рассмотрим баллистическое движение электрона через МТК полагая, что потенциальная энергия в изолирующем слое *I* с учётом приложенного напряжения имеет вид

$$U'(x) = U - \frac{eV(x+d/2)}{d} - \frac{d}{2} \le x \le +\frac{d}{2}, \quad (1)$$

где U - высота потенциального барьера, V - приложенное напряжение, d - толщина изолятора. В одномерном случае состояния движения электрона проводимости могут быть найдены из решений уравнения Шрёдингера:

$$\left(H_{s}^{\prime}-E_{F,s}^{\prime}\right)\left(\begin{array}{c} \psi_{\uparrow}(x;k_{y},k_{z})\\ \psi_{\downarrow}(x;k_{y},k_{z})\end{array}\right)=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},$$
(2)

где гамильтонианы в слоях l = L, I, R имеют вид

$$H_{s}^{L} = -\frac{\hbar^{2}}{2m_{L}} \left( \frac{d^{2}}{dx^{2}} + k_{||}^{2} \right) \pm J_{ex}^{L}, \qquad (3)$$

$$H_{s}^{I} = -\frac{\hbar^{2}}{2m_{I}}\frac{d^{2}}{dx^{2}} + U^{I}(x), \qquad (4)$$

$$H_{s}^{R} = -\frac{\hbar^{2}}{2m_{R}} \left(\frac{d^{2}}{dx^{2}} + k_{||}^{2}\right) - eV + H_{ex}^{R}.$$
 (5)

Здесь  $k_{||}^2 = k_y^2 + k_z^2$  - сохраняющаяся компонента волнового вектора в плоскости контакта,  $m_l$ эффективные массы электронов в трёх областях, соответственно (l = L, I, R),  $J_{ex}^L$  - обменная энергия в FM<sup>L</sup> электроде. Последнее слагаемое в (5) определяет обменную энергию  $J_{ex}^R$  и направления намагниченностей подрешёток AFM<sup>R</sup> слоя:

$$H_{ex}^{R} = J_{ex}^{R} \begin{pmatrix} \cos\theta_{1} + \cos\theta_{2} & \sin\theta_{1} + \sin\theta_{2} \\ \sin\theta_{1} + \sin\theta_{2} & -\cos\theta_{1} - \cos\theta_{2} \end{pmatrix}, \qquad (6)$$

где углы  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  изменяются от направления намагниченности FM<sup>L</sup> электрода (оси *z*) и отличаются на угол  $\pi$ .

Решая систему дифференциальных уравнений (2) и сшивая эти решения с помощью метода трансферматрицы, найдем амплитуды вероятностей падающих и отражённых волн, которые определяют матричные элементы коэффициента прохождения:

$$\mathbf{A}_{s(s')}^{L} = T_{s,s'(s',s)} \mathbf{A}_{s(s')}^{R}.$$
 (7)

Здесь амплитуды  $\mathbf{A}_{s(s')}^{L}$ ,  $\mathbf{A}_{s(s')}^{R}$  представляют собой матрицы столбцы 4-го порядка для каждой компоненты спина  $s = \uparrow, \downarrow$ . Также отметить, что при углах  $(\theta_1 + \theta_2)/2 \neq 0$ , отражённая компонента падающей волны, например, со спином  $\uparrow$  содержит также примесь компоненты со спином  $\downarrow$ , и наоборот отраженная волна со спином  $\downarrow$  содержит примесь компоненты волны со спином  $\uparrow$ .

#### Кондактанс и ТМС

Спин-поляризованный контактанс, усреднённый по телесному углу левой стороны контакта, имеет вид

$$G = \sum_{s,s'} \frac{e^2 \left(k_{F,s}^L\right)^2 A}{4\pi^2 \hbar} \left\langle \cos \gamma_{L,s}, T_{s,s'} \left( \cos \gamma_{L,s} \right) \right\rangle_{L,s}, \quad (8)$$

где A- площадь контакта,  $k_{F,s}^{L}$ - волновой вектор Ферми FM<sup>L</sup> слоя,  $\gamma_{L,s}$ - угол между осью x и направлением движения электрона к границе FM<sup>L</sup>/I. В (8) для простоты не указана зависимость  $T_{s,s'}$  от углов  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  и приложенного напряжения V. Отметим, что расчёт кондактанса (8) нами уже выполнялся ранее для планарных МТК, но без антиферромагнитного слоя [2].

Известно, что сопротивления МТК отличаются при различных ориентациях намагниченностей смежных магнитных электродов. Поэтому в нашем случае ТМС мы будем определять отношением:

$$\operatorname{TMR}_{\operatorname{AFM}} = \left(\frac{G(\theta_1 + \delta, \theta_2 + \delta)}{G(\theta_1, \theta_2)} - 1\right) \times 100\%, \quad (9)$$

где  $\delta$ - угол отклонения антиколлинеарных намагниченностей подрешёток AFM<sup>*R*</sup> от оси *z*. Результат вычисления ТМС для МТК при параметрах, соответствующих экспериментальным данным, показан на рисунке 2.



**Рис. 2.** Зависимости ТМС от приложенного напряжения и параметров МТК

#### Литература

- V. Baltz, A. Manchon, M. Tsoi *et al.* // Reviews of Modern Physics, V. 90, 015005 (2018).
- А. М. Исмаили, А. Н. Усеинов, Н. Х. Усеинов // ЖЭТФ, Т. 153, вып. 1, С. 137 (2018).